



TOPIC

1. Publication of Reference Materials for Inventive Step Examination
進歩性の審査に関する参考資料の公表
2. Fiscal 2020 IP Strategy Designer Dispatches - Recruitment Begins
2020年度知財戦略デザイナー派遣事業の募集開始
3. The Effect of Brexit on Trademarks and Designs
英国のEU離脱(ブレグジット)による商標・意匠への影響
4. Results of Investigations into Trends in Patent Applications etc. Published
出願動向調査等の結果の公表
5. Revised Design Law
改正意匠法



Publication of Reference Materials for Inventive Step Examination 進歩性の審査に関する参考資料の公表

The Japan Patent Office published "Important Points and Reference Examples for Inventive Step Examination" as an examination guideline reference material on January 29, 2020.

This reference material does not change the examination guidelines, but indicates vital points on examining inventive step as part of the examination guidelines, along with hypothetical examples.

With the publication of this reference material, applicants and representatives (below, "applicants etc.") can clearly understand the points examiners scrutinize and the matters they consider etc. when carrying out examination of inventive step.

Thus, it is thought that the publication of this reference material will reduce misunderstandings and needless communication between applicants etc. and examiners during examination of inventive step, and contribute to faster examinations and speedier acquisition of patent rights.

Some of the important points contained in the reference material are as follows.

- The inventions of claims are identified based on the written content of said claims. Any matters written in the specification or drawings but not in the claims will not be made the subject of the examination.
- Judgment of inventive step is carried out based on a comprehensive evaluation of both facts that deny inventive step and facts that support inventive step.
- Facts that deny inventive step would be, for example, (a) motivation for applying a secondary source to a primary source, (b) a point of difference between the subject invention and an invention described in a primary source that can be reasonably interpreted as a design difference, and (c) a reasonable interpretation of the subject invention as merely a patchwork of prior art, etc.
- Facts that support inventive step would be, for example, (a) the subject invention having an advantageous effect over the inventions contained in the cited documents, (b) the existence of a primary hindering factor against the application of a secondary source to a primary source, etc.
- In a case where a claim of the subject invention contains a numerical limit that defines the invention of said claim, if the only point of difference between said claim and a primary cited invention is said numerical limit, the invention of said claim will generally be considered to lack inventive step, unless the following three requirements (i-iii) are all met.
 - (i) The invention of the claim has an advantageous effect that takes place within the range specified by the numerical limit and which is not present in the cited invention.
 - (ii) Said advantageous effect is notable.
 - (iii) Said advantageous effect could not have been predicted by a person skilled in the art based on the standard of technology at the time of filing the application.

In addition, in order for said advantageous effect to have notability, it is necessary to indicate that the advantageous effect is notable at all values within the range specified by the numerical limit.

審査基準の参考資料である「進歩性の審査の進め方の要点と参考事例」が、2020年1月29日に、特許庁から公表された。

上記参考資料は、審査基準を変更するものではないが、審査基準における進歩性の審査の進め方の要点を、

仮想事例と共に提示している。

上記参考資料の公表により、出願人および代理人（以下、「出願人等」と称する）が、審査官が進歩性の審査を行う際に、注目する点および考慮する事項等をより明確に理解できるようになると考えられる。

よって、上記参考資料の公表は、進歩性の審査における、出願人等と審査官との間の誤解および無駄なやり取り等を削減し、審査の迅速化および特許権の早期権利化等に寄与すると考えられる。

上記参考資料において、上記要点として、例えば、以下に示す事項が挙げられている。

- ・請求項に係る発明を認定する際は、請求項の記載に基づいて行い、請求項に記載されておらず、明細書又は図面にのみ記載された事項は、審査の対象としない。
- ・進歩性の判断は、進歩性が否定される方向に働く諸事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実を総合的に評価して行う。
- ・上記進歩性が否定される方向に働く諸事実としては、例えば、（a）主引例に副引例を適用する動機付けがあること、（b）審査対象の発明と主引例に記載の発明との相違点が設計変更であると解釈され得る相違点であること、および（c）審査対象の発明が、先行技術の単なる寄せ集めであると解釈され得ること、等が挙げられる。
- ・上記進歩性が肯定される方向に働く諸事実としては、例えば、（a）審査対象の発明が、引例に記載の発明に対して有利な効果を奏すること、（b）主引例に副引例を適用することに対する阻害要因が存在すること、等が挙げられる。
- ・請求項に数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合において、主引用発明との相違点はその数値限定のみにあるときは、発明の効果について、以下の（i）から（iii）までの全てを満たす場合を除き、通常、その請求項に係る発明における進歩性は認められない。
 - （i）請求項に係る発明の効果が、上述の限定された数値の範囲内において奏され、その効果が引例に開示されていない有利な効果であること。
 - （ii）上記有利な効果が、顕著性を有していること。

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

Venture Support Station ベンチャー・共創支援室

We provide services of the highest standard by combining expert knowledge —cultivated through decades of experience— with unique analytical capabilities that only a large-scale international IP firm can offer.

[Click here for details](#)

長年の経験で培ったノウハウと、国際特許事務所ならではの能力を組み合わせ、質の高いサービスを提供致します。

[詳細はこちらへ](#)

(iii) 上記有利な効果が、出願時の技術水準から当業者が予測できた効果ではないこと。

なお、上記有利な効果が顕著性を有しているといえるためには、数値範囲内の全ての数値において、上記有利な効果に顕著性があることを示す必要がある。

Fiscal 2020 IP Strategy Designer Dispatches - Recruitment Begins 2020年度知財戦略デザイナー派遣事業の募集開始

Since fiscal 2019, the Japan Patent Office has dispatched IP strategy designers to universities in order to discover outstanding research results and design IP strategies in the sightline of researchers.

On February 5, 2020, the JPO held an explanatory recruitment meeting for universities who wish to receive IP strategy designer dispatches in fiscal 2020. Recruitment began the same day. The deadline for applications ends at midday on March 2, 2020.

There are two types of IP strategy designer dispatches: permanent placements and spot placements.

Permanent placements: after an agreement has been signed, permanent placements will commence as soon as preparations have been made and continue until Friday, March 26, 2021. Around 2-3 days a week will be spent at the dispatch destination.

Spot placements: after an agreement has been signed, spot placements will take place for either 24 or 12 days in the period between when preparations have been made and Friday, March 26, 2021.

This time, six universities will be recruited for permanent placements and 12 universities will be recruited for spot placements.

The project aims to spread the knowledge and knowhow obtained through working on IP strategy design, discover outstanding research results, encourage further research based on IP strategy and support universities engaged in promoting societal implementation.

To this end, IP strategy designers dispatched to universities will carry out the following work (a-c):

- (a) Form teams with Research Administrators and other persons responsible for supporting researchers, and work to discover outstanding research results for which no IP protection has yet been planned which sharing knowledge and knowhow.
- (b) Provide researchers with plans for future prospects such as development of large-scale collaborative research or industrialization.
- (c) In order to realize researchers' future ambitions, design IP strategies for research results that should be protected and time the acquisition of IP etc. in the sightline of researchers. Support the use of IP rights to create value in society and the economy.

Outstanding research results at universities as well as knowledge and knowhow on IP strategies that have been discovered via this project (excluding confidential information and personal information) will be collected and published.

Thus, by carrying out the dispatch project each year, universities and researches that do not receive IP strategy designers will also benefit from the publication of IP strategy policies, knowledge and knowhow, etc. As a result, it is thought that the project will promote research based on IP strategy throughout Japan.

In fiscal 2019, IP strategy designers were dispatched to the following 21 universities:

Iwate University, Oita University, Osaka University, Osaka Institute of Technology, Okayama University, Ochanomizu Women's College, Kyushu University, Kyoto University, Saitama University, Jochi University, Shinshu University, Chiba University, Tsukuba University, University of Tokyo, Tokyo Institute of Technology, Tokyo Denki University, Tohoku University, Tokushima University, Tottori University, Toyama University, Nagaoka University of Technology, Nara Medical University, Niigata University, Hiroshima University, Fukushima University, Mie University, Ritsumeikan University, Wakayama Medical University.

昨年2019年度から、特許庁は、大学に対して、優れた研究成果を発掘し、研究者目線で知財戦略をデザインする知財戦略デザイナーを派遣する、知財戦略デザイナー派遣事業を開始している。

そして、本年2020年度の知財戦略デザイナーの派遣先大学の募集の説明会が、2020年2月5日に実施され、当該募集が開始された。当該募集の申込み期限は、2020年3月2日の12:00である。

上記知財戦略デザイナーの派遣には、常駐型とスポット型の2つの形態がある。

常駐型の派遣は、派遣協定締結日以降、準備ができ次第～令和3年3月26日（金）までの間で、週あたり2～3日の派遣である。

スポット型の派遣は、派遣協定締結日以降、準備ができ次第～令和3年3月26日（金）までの間で、24

日又は12日程度の派遣である。

募集数は、常駐型の派遣が6大学程度、スポット型の派遣が12大学程度の予定である。

本事業は、本事業全体を通して得られた知見やノウハウを広め、優れた研究成果の発掘、知財戦略に基づく更なる研究の発展および社会実装の推進に取り組む大学を支援していくことを目的としている。

そのため、派遣された知財戦略デザイナーは、以下の(a)～(c)に示す作業を行う。

(a) リサーチ・アドミニストレーター(URA)をはじめとする研究支援担当者とチームを組み、知見やノウハウを共有しながら、知的財産権の保護が図られていない研究成果の発掘を行う。

(b) 研究者に対して、例えば、大型共同研究への発展や事業化などの未来展望を提案する。

(c) 研究者が目指したい未来を実現するため、保護すべき研究成果および知財取得のタイミングなどの知財戦略を研究者目線でデザインし、知的財産権の活用を通じた社会的価値・経済的価値の創出を支援する。

また、本事業を通して得られる、大学における優れた研究成果の発明発掘や知財戦略策定の知見やノウハウは、機密情報及び個人情報を除いて、取りまとめられ、公表される予定である。

よって、本事情が毎年実施されていくことにより、知財戦略デザイナーが派遣されていない大学および研究者にも、上述の知財戦略策定の知見やノウハウ等が公表されていくこととなる。その結果、日本全体において、知財戦略に基づく研究が進められていくことになると考えられる。

なお、2019年度は、以下に示す28の大学に対して、知財戦略デザイナーの派遣が行われた。

・岩手大学、大分大学、大阪大学、大阪工業大学、岡山大学、お茶の水女子大学、九州大学、京都大学、埼玉大学、上智大学、信州大学、千葉大学、筑波大学、東京大学、東京工業大学、東京電機大学、東北大学、徳島大学、鳥取大学、富山大学、長岡技術科学大学、奈良県立医科大学、新潟大学、広島大学、福島大学、三重大学、立命館大学および和歌山県立医科大学

The Effect of Brexit on Trademarks and Designs 英国のEU離脱(ブレグジット)による商標・意匠への影響

An agreement was reached on the United Kingdom's withdrawal from the European Union. As a result, the UK left the EU on January 31, 2020, and entered a transition period that will last from February 1, 2020 to December 31, 2020. During the transition period, EU laws will continue to be in effect in the UK. Trademarks and Designs will be affected in the following way (detailed information can be found on the Japan External Trade Organization (JETRO) website (Japanese only):

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2020/20200203.pdf.

• Trademarks

(1) During the transition period

Throughout this period, the UK will remain a part of the EU Trademark System, and protection for EU trademarks will apply in the UK. International trademark registrations under the Madrid Protocol that designate the EU will continue to be effective in the UK.

(2) After the transition period

At the time the transition period ends (January 1, 2021), the United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO) will grant equivalent UK registrations to holders of existing EU trademarks (withdrawal agreement article 54). Applicants for EU trademarks whose applications are still pending when the transition period ends may apply for equivalent UK trademark registrations during a nine-month period starting January 1, 2021. In this case, normal UK fees will apply, and the effective application date will be that of the prior EU application (withdrawal agreement article 59).

International trademark registrations that were protected prior to the end of the transition period will continue to be effective in the UK after December 31, 2021.

• **Designs**

(1) During the transition period

Throughout this period, the UK will remain a part of the EU Registered Community Design System as well as the Unregistered Community Design System. Registered community designs and unregistered community designs will continue to be protected in the UK. International design registrations under the Hague Agreement that designate the EU will continue to be effective in the UK.

(2) After the transition period

At the time the transition period ends (January 1, 2021), the effects of registered community designs, unregistered community designs and international design registrations will immediately and automatically be substituted for UK rights (withdrawal agreement articles 54 and 56). Applicants for registered community designs whose applications are still pending when the transition period ends may apply for equivalent UK design registrations during a nine-month period starting January 1, 2021. In this case, normal UK fees will apply, and the effective application date will be that of the prior registered community design application (withdrawal agreement article 59).

英国及び欧州連合（EU）は離脱協定を承認した。これにより、2020年1月31日に英国はEUを離脱し、移行期間（2020年2月1日～2020年12月31日）が開始される。移行期間中は、EU法が引き

続き現在と同様に英国において効力を有する。商標及び意匠への影響は以下の通りである。（詳細については日本貿易振興機構（ジェトロ）の記事に記載

(URL⇒https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2020/20200203.pdf)

・商標

(1) 移行期間中

引き続き、英国はEU商標制度の構成国の一部のみとなり、EU商標による保護は英国に及ぶ。マドリッド制度を通じて保護されるEUを指定する商標の国際登録の効果は、引き続き英国に及ぶ。

(2) 移行期間終了後

移行期間の終了時（2021年1月1日）に、英国知的財産庁（UKIPO）は、既存のEU商標を有するすべての権利者に同等の英国商標を付与する（離脱協定第54条）。移行期間終了時に係属中のEU商標出願を有する場合、出願人は2021年1月1日の後9ヶ月以内に同等の英国商標を登録するための出願を行うことが出来る。出願人は、継続中のEU商標の先の出願日を維持し（離脱協定第59条）、通常の英国の料金が適用される。

なお、移行期間終了前に保護されている商標の国際登録は、2020年12月31日の後も引き続き英国において保護される。

・意匠

(1) 移行期間中

引き続き、英国は欧州登録共同体意匠制度及び非登録共同体意匠制度の構成国の一部のみとなり、登録共同体意匠及び非登録共同体意匠による保護は英国に及ぶ。ハーグ制度を通じて保護されるEUを指定する意匠の国際登録の効果は、引き続き英国に及ぶ。

(2) 移行期間終了時

移行期間終了時（2021年1月1日）に、登録共同体意匠、非登録共同体意匠、及びEUを指定して保護された意匠の国際登録の効果は、直ちにかつ自動的に英国の権利に置き換えられる（離脱協定第54、56条）。出願人は、2021年1月1日時点で係属中の登録共同体意匠出願を有する場合、2021年1月1日の後9ヶ月以内に英国意匠を登録するために出願することができ、係属中の登録共同体意匠の先の出願日を維持でき（離脱協定第59条）、通常の英国の料金が適用される。

Results of Investigations into Trends in Patent Applications etc. Published 出願動向調査等の結果の公表

On February 14, 2020, the Japan Patent Office published results of its investigations into trends in patent applications etc. in the cutting-edge fields of robotics and systems utilizing robotics (below, "robotics etc."), genome editing, bioprocesses, redox flow batteries and IT platform services, as part of its investigation into trends in in needs-responsive technologies.

Some of the results of the investigations are as follows.

In the field of robotics etc., between 2008 and 2017 the largest proportion of applications (44.0%) was filed by Chinese applicants. The next largest proportion (18.0%) was filed by Japanese applicants, followed by US applicants (17.2%).

There is a trend for growth in the overall number of applications in the field of robotics etc. There is a particularly notable growth in applications by Chinese applicants.

In the field of genome editing, between 2008 and 2017 the largest proportion of applications (54.8%) was filed by US applicants. The next largest proportion (17.6%) was filed by Chinese applicants, followed by European applicants (16.4%). Meanwhile, Japanese applicants accounted for only 4.1% of applications. There is an increase in the number of applications in the field of genome editing from all countries and regions. There is a particularly notable growth in applications by US and Chinese applicants.

In the field of bioprocesses, between 2012 and 2017 the largest proportion of applications (61.4%) was filed by Chinese applicants. The next largest proportion (13.1%) was filed by US applicants, followed by European applicants (13.0%) and Japanese applicants (6.9%). Applications by European, US and Japanese applicants have each seen a trend for decreasing since 2015. Meanwhile, there has been a notable increase in applications filed by Chinese applicants. The share of applications filed by Chinese applicants is also much higher than that of applicants from other countries or regions.

In the field of redox flow batteries, between 2003 and 2017 the largest proportion of applications (23.7%) was filed by US applicants. This was closely followed by Japanese applicants (23.2%), then Korean applicants (18.8%) and Chinese applicants (15.5%). There is a trend for growth in the overall number of applications in

the field of redox flow batteries. There is a particularly notable growth in applications by Japanese and Korean applicants.

In the field of IT platform services, between 2008 and 2017 the largest proportion of applications (43.2%) was filed by US applicants. The next largest proportion (24.6%) was filed by Chinese applicants, followed by Korean applicants (12.5%). Meanwhile, Japanese applicants only accounted for 10.0%. There is a trend for slight reduction in the number of applications by US applicants, but a trend for growth in the number of applications by Chinese applicants.

As described above, there has been a notable growth in the number of applications in cutting-edge fields by Chinese applicants. This trend is likely to continue in the future, with the number of applications by Chinese applicants continuing to rise.

2020年2月14日に、特許庁から、ニーズ即応型技術動向調査として、ロボット及びロボットを活用するシステム（以下、「ロボット等」と称する）、ゲノム編集、バイオプロセス、レドックスフロー電池およびITプラットフォームサービスといった最先端の技術分野における出願動向調査等の結果が公表された。

その結果の一部を以下に示す。

「ロボット等」の分野の、2008～2017年における、出願件数について、中国籍の出願人による出願件数が、44.0%と最多であった。それに続いて、日本籍の出願人による出願件数が18.0%、米国籍の出願人による出願件数が17.2%であった。

「ロボット等」の分野の出願数は、全体として増加傾向を示していた。その中でも中国籍の出願人による出願数の伸びが顕著であった。

「ゲノム編集」の分野の、2008～2017年における、出願件数について、米国籍の出願人による出願件数が、54.8%と最多であった。それに続いて、中国籍の出願人による出願件数が17.6%、欧州国籍の出願人による出願件数が16.4%であった。一方、日本籍の出願人による出願件数は、わずか4.1%であった。

「ゲノム編集」の分野の出願数は、すべての国籍・地域で増加傾向を示していた。その中で、米国籍の出願人による出願数および中国籍の出願人による出願数の伸びが顕著であった。

「バイオプロセス」の分野の、2012～2017年における、出願件数について、中国籍の出願人による出願件数が61.4%と最多であった。それに続いて、米国籍の出願人による出願件数が13.1%であり、欧州籍の出願人による出願件数が13.0%であり、日本籍の出願人による出願件数が6.9%であった。

欧州籍の出願人による出願件数、米国籍の出願人による出願件数、および日本籍の出願人による出願件数は、いずれも2015年以降はほぼ減少傾向を示していた。一方、中国籍の出願人による出願件数のみは顕著な伸びを示していた。件数シェアも中国籍が圧倒的であった。

「レドックスフロー電池」の分野の、2003～2017年における、出願件数について、米国籍の出願人による出願件数が、23.7%と最多であった。そして、日本籍の出願人による出願件数が、23.2%と僅差で続き、韓国籍の出願人による出願件数が18.8%、中国籍の出願人による出願件数が15.5%であった。

「レドックスフロー電池」の分野の出願数は、全体として増加傾向にあり、特に、日本、中国および韓国の出願人による出願件数が、顕著に増加していた。

「ITプラットフォームサービス」の分野の、2008～2017年における、出願件数について、米国籍の出願人による出願件数が、43.2%と最多であった。それに続いて、中国籍の出願人による出願件数が24.6%、韓国籍の出願人による出願件数が12.5%であった。一方、日本籍の出願人による出願件数は、わずか10.0%であった。

「ITプラットフォームサービス」の分野の出願数は、米国籍の出願人による出願件数は減少傾向にあるのに対して、中国籍の出願人による出願件数は、増加傾向であった。

上述のとおり、最先端の技術において、中国の出願人による出願件数が顕著に増加していた。

この流れは、現在から将来にかけても続くと考えられ、中国の出願人による出願件数は今後も増大すると考えられる。

Revised Design Law 改正意匠法

The revised Design Law will come into effect from April 1, 2020. The specifics of the revised Design Law are as follows:

1. Expansion of what may be protected as an Image Design

(1) New items eligible for protection

(Limited to images that are used for operation of machines or images that show an outcome derived from a machine's function.)

(i) Images that are not recorded on articles

e.g.) Images provided via networks

(ii) Images that are displayed on things other than articles

e.g.) Images cast on walls or bodies or images shown in VR

(2) New acts that constitute working of designs

Acts of uploading images to a server, providing software including images via a network, or offering to do so are now considered to be acts of working designs.

(Transferring media on which images related to a design are recorded or devices that contain built-in images related to a design etc. is considered an act of working said design.)

2. Protection of Spatial Designs

The exterior and interior designs of architecture are newly subject to protections.

3. Expansion of Related Design System

(i) The period in which an application for a related design may be filed has been extended from 'before publication of the principal design' to 'within 10 years from the filing date of principal design'.

(ii) Related designs similar only to other related designs may now be registered.

(iii) The period of duration of related designs has been adjusted to be equal to that of the basic design (the earliest design in the group).

4. Change to Period of Duration of Design Rights

The period of duration of design rights has been extended from '20 years from the registration date' to '25 years from the filing date'.

5. Raising Standards for Difficulty of Design

It has been clarified that the publication of designs in print or online is to be considered when judging difficulty of design.

6. Introduction of Partial Designs for Sets of Articles

Designs for sets of articles may be registered as partial designs.

7. Expansion of Indirect Infringement Regulations

Acts of production, transference, import etc. of (non-dedicated) components that comprise infringing articles, if malicious, are considered to be indirect infringement.

いよいよ、2020年4月1日に改正意匠法が施行される。ここでもう一度 具体的な意匠法改正の内容を説明する。

1. 画像デザインの保護対象の拡大

(1) 新たな保護対象 (機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られる。)

①物品に記録されていない画像

例) ネットワークによって提供される画像

②物品以外に表示される画像

例) 壁や人体に投影される画像、VR上で表示される画像等

(2) 新たな実施行為

画像をサーバーにアップロードする行為や、ネットワークを通じて画像を含むソフトウェアを提供する行為やその申出をする行為も、意匠の実施行為となった。

(意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器の譲渡等も実施行為となる。)

2. 空間デザインの保護

建築物の外観・内装のデザインが、新たに意匠法の保護対象となった。

3. 関連意匠制度の拡充

①関連意匠の出願可能期間が、「本意匠の公報発行日前」から、「本意匠の出願日から10年以内」に延長された。

②関連意匠にのみ類似する関連意匠の登録が認められた。

③関連意匠の存続期間を基礎意匠(一群のなかの最先の意匠)と合わせた。

4. 意匠件の存続期間の変更

意匠権の存続期間が「登録日から20年」から「出願日から25年」に延長された。

5. 創作非容易性の水準の引き上げ

刊行物やインターネット上で公開されている意匠についても判断要素とすることを明記する。

6. 組物の部分意匠の導入

組物の意匠についても、部分意匠として登録できる。

7. 間接侵害規定の拡充

侵害品を構成する部品（非専用品）の製造・譲渡・輸入等の行為について、悪意の場合には、間接侵害に該当することとした。



Please contact us if you have any comments or require any information.

Please acknowledge that the purpose of our column is to provide general information on the field of intellectual property, and that the description here does not represent our legal opinion on a specific theme.

Please visit our facebook pages below.

Our Legal Strategy Department on Facebook
法務戦略部Facebook

Our Legal Strategy Departments based in Osaka and Tokyo provide information on trademark applications, design applications, combating counterfeit goods etc. via Facebook. Please view our Facebook page for more details.

大阪・東京に拠点を置く法務戦略部のFacebookにて、商標出願・模倣品対策・意匠出願などの知財に関する情報を発信しております。ぜひご覧下さい。

[More information](#) [詳細はこちらへ](#)

HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

Our Hiroshima Office on Facebook
広島事務所Facebook

Our Hiroshima Office's Facebook page provides useful services for Hiroshima prefecture and the rest of the Chugoku and Shikoku regions, with constant IP information updates. Please find us on Facebook.

広島事務所のFacebookにて、広島県を含む、中四国地域の皆様に有用と思われる知財情報を随時発信しております。ぜひご覧下さい。

[More information](#) [詳細はこちらへ](#)

HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK HIROSHIMA OFFICE
 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 広島事務所

Below are links to further IP information.

BIO IP Information

バイオ知財情報

IT IP Information

IT知財情報

IoT × AI Support Station

IoT×AI支援室

Food & Medical Business Support Station

食品×医療支援室

Major & Emerging Economic Powers

諸外国知財情報

TPP I.P. Chapter

TPP知財情報

TOKYO HEAD OFFICE

ADDRESS:
 WORLD TRADE CENTER BLDG. 21F
 2-4-1, HAMAMATSU-CHO, MINATO-KU,
 TOKYO 105-6121, JAPAN

TELEPHONE:
 +81-3-3433-5810 (Main Number)

FACSIMILE:
 +81-3-3433-5281 (Main Number)

WEBSITE:
<http://www.harakenzo.com>
<http://trademark.ip-kenzo.com>
<http://design.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

E-MAIL:
iplaw-tky@harakenzo.com



OSAKA HEAD OFFICE

ADDRESS:
 DAIWA MINAMIMORIMACHI BLDG.,
 2-6, 2-CHOME-KITA, TENJINBASHI, KITA-KU,
 OSAKA 530-0041, JAPAN

TELEPHONE:
 +81-6-6351-4384 (Main Number)

FACSIMILE:
 +81-6-6351-5664 (Main Number)

WEBSITE:
<http://www.harakenzo.com>
<http://trademark.ip-kenzo.com>
<http://design.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

E-MAIL:
iplaw-osk@harakenzo.com



OSAKA 2nd OFFICE

ADDRESS:
 MITSUI SUMITOMO BANK
 MINAMIMORIMACHI BLDG., 1-29,
 2-CHOME, MINAMIMORIMACHI, KITA-KU,
 OSAKA 530-0054, JAPAN

TELEPHONE:
 +81-6-6351-4384 (Main Number)

FACSIMILE:
 +81-6-6351-5664 (Main Number)

WEBSITE:
<http://www.harakenzo.com>
<http://trademark.ip-kenzo.com>
<http://design.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

E-MAIL:
iplaw-osk@harakenzo.com



HIROSHIMA OFFICE

ADDRESS:
 NOMURA REAL ESTATE
 HIROSHIMA BLDG. 4F
 2-23, TATEMACHI, NAKA-KU, HIROSHIMA
 730-0032, JAPAN

TELEPHONE:
 +81-82-545-3680 (Main Number)

FACSIMILE:
 +81-82-243-4130 (Main Number)

WEBSITE:
<http://www.harakenzo.com>
<http://trademark.ip-kenzo.com>
<http://design.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

E-MAIL:
iplaw-hsm@harakenzo.com



NAGOYA OFFICE

ADDRESS:
 GLOBAL GATE 9F, 4-60-12 HIRAIKE-CHO,
 NAKAMURA-KU, NAGOYA-SHI, AICHI
 453-6109, JAPAN

TELEPHONE:
 +81-52-589-2581 (Main Number)

FACSIMILE:
 +81-52-589-2582 (Main Number)

WEBSITE:
<http://www.harakenzo.com>
<http://trademark.ip-kenzo.com>
<http://design.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

E-MAIL:
iplaw-ngy@harakenzo.com

